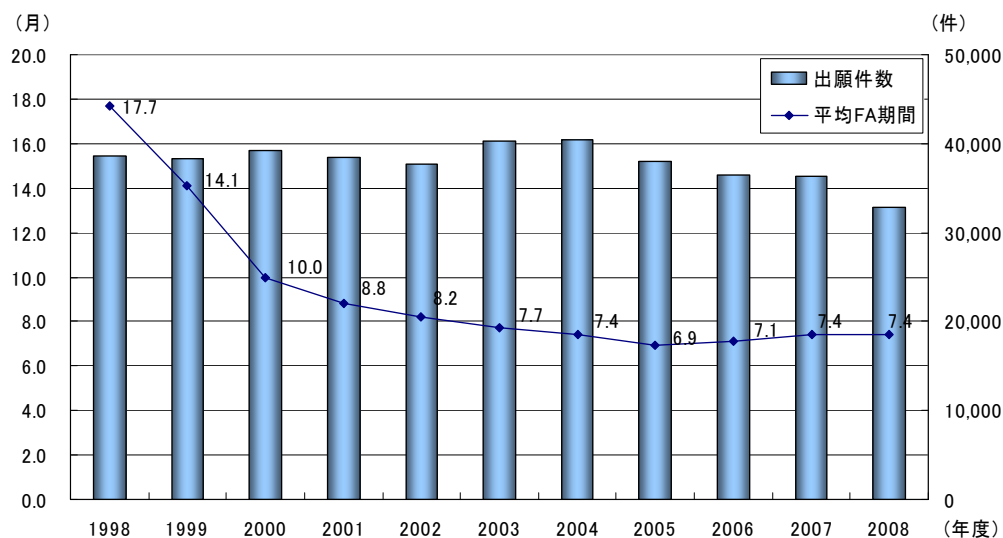


意匠制度の現況及び今年度の検討項目について

I. 意匠制度の現況

1. 意匠登録出願、審査の動向について

ここ 10 年間における出願件数はほぼ 4 万件弱で推移しているが、2005 年以降は減少傾向が続いている。平均 F A（審査順番待ち期間）は 7 ヶ月を達成している。



2. 国際関係の動き

(1) 本年度のこれまでの会合

① 第 21 回商標・意匠・地理的表示の法律に関する常設委員会 (SCT)

(2009 年 6 月 22 日-26 日、スイス・ジュネーブ、WIPO)

「意匠法及び実務における収束可能な範囲」について議論を行い、各国における手続きを中心に意見交換が行われた。

② 日米欧中国意匠セミナー

(2009 年 6 月 3 日-4 日、中国・広東省)

日本、米国、欧州、中国の共催により、2009 年 6 月に、各国の意匠制度や運用を中国における実務者等へ紹介するセミナーが開催された。

（２）本年度の今後の会合（予定）

- ① 第 22 回商標・意匠・地理的表示の法律に関する常設委員会（SCT）会合
（2009 年 11 月 23 日－26 日予定、スイス・ジュネーブ、WIPO）
- ② 第 5 回日欧意匠審査官会合
（2009 年 11 月 24 日予定、日本国特許庁）
- ③ 第 8 回商標三極会合における意匠セッション
（2009 年 12 月 10 日予定、スペイン・アリカンテ、OHIM）
- ④ 第 5 回日中審判会合（意匠）
（2009 年 12 月 14 日－15 日予定、日本国特許庁）
- ⑤ 第 9 回日韓意匠専門家会合
（2010 年 2 月 24 日－25 日予定、日本国特許庁）

Ⅱ．今年度の検討項目

1. 『知的財産推進計画 2009』における指摘とこれまでの取り組み

（→参考資料 1、1－1、1－2、1－3 参照）

『知的財産推進計画 2009』においては、「意匠の権利範囲（登録意匠の類似範囲や部分意匠の権利範囲）の明確化及びデザイナーの創作基盤の整備を図るため、意匠審査基準の明確化を進めるとともに、特許庁の公知意匠資料データベースの公開促進のための方策の在り方について検討を行い、2009 年度中に結論を得る。」¹とされている。

意匠の権利範囲は司法の場で決せられることではあるが、意匠権は、特許庁で、出願前に公然知られた意匠と類似するか否かの審査を経て発生するものであるため、意匠審査基準、個別の出願に対する審査判断、及び意匠審査で参考とした審査資料の一般公開等、特許庁での意匠の類似範囲の明確化への取り組みが、意匠の権利範囲の明確化へ大きな影響を及ぼすものと考えられる。

特許庁ではこれまでも、意匠の類似範囲の明確化について、（１）法改正による判断主体の明確化²、（２）意匠審査基準の改訂による類否判断基準の明

¹ 知的財産戦略本部『知的財産推進計画 2009』26 頁（2009 年 6 月 24 日）

² 平成 18 年法律改正（平成 18 年法律第 55 号）により、意匠法第 24 条第 2 項を新設し、類否判断の判断主体を「需要者」であることを明確にした。なお、ここでいう「需要者」とは、取引者も含む概念とされている。

確化、(3) 拒絶理由通知書への類否判断の具体的理由の記載³、(4) 特許電子図書館 (IPDL) による意匠公知資料の公開への取り組み等、様々な施策を講じてきている。

2. 今年度の検討項目

(1) 「審査の進め方」の策定

意匠の類似範囲の明確化において意匠審査基準が果たすことのできる役割の一つは、意匠審査における各判断の場面での判断プロセスを明確化することと考えられる。また、類否判断に直結する先行意匠調査の方法及び調査結果の記録 (参考文献の記録) について明文化することは、意匠の類似範囲の明確化に資するものと考えられる。

そこで今年度は、意匠審査全体の判断プロセス並びに先行意匠調査の方法及び調査結果の記録 (参考文献の記録) の明文化として「審査の進め方」の策定を行う。

「審査の進め方」において、意匠審査において判断すべき各事項について、実際の審査の流れに沿った記載を行うとともに、意匠審査基準の該当箇所を明示することにより、意匠審査の各段階において審査官がどのような判断を行っているのか、そして手続きの各段階において意匠審査基準のどの箇所を参照すればよいのかが明確になることも期待される。

(2) 意匠公知資料データベースの公開促進のための方策の在り方の検討

特許庁で構築している意匠公知資料データベースについて、意匠の権利範囲の明確化や企業等における優れたデザイン開発に役立てるために公開を求める要望があるが、個々の公知意匠のイメージデータについては、著作権により著作権者の許可なく公開することができない。

特許庁では、平成 17 (2005) 年度より、前年度に蓄積した国内企業のホームページに掲載された新製品情報を中心として、許諾が得られたもののみ特許電子図書館 (IPDL) において公開をしている。しかしながら、許諾を頂くにあたり、著作権の確認作業等、多大な負担をかけており、許諾が得られるのも一部の資料にとどまっている。

そこで、意匠公知資料データベースの公開促進について、その在り方を検討する。

³ 平成 16 年 1 月より、意匠法第 9 条第 1 項 (先願) の拒絶理由通知書において、引用意匠の記載に加えて出願に係る意匠と引用意匠とが類似する具体的理由を簡潔に記載する運用を開始し、平成 19 年 4 月からは意匠法第 3 条第 1 項第 3 号 (新規性) 及び意匠法第 3 条の 2 (先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠の保護除外) にも当該運用を拡大した。